【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第３区分
【発行日】平成24年10月25日(2012.10.25)

【公開番号】特開2011-62774(P2011-62774A)
【公開日】平成23年3月31日(2011.3.31)
【年通号数】公開・登録公報2011-013
【出願番号】特願2009-215332(P2009-215332)
【国際特許分類】
Ｂ２４Ｂ　37/12　(2012.01)
Ｂ２４Ｂ　37/08　(2012.01)
Ｂ２４Ｂ　37/16　(2012.01)
Ｈ０１Ｌ　21/304　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ２４Ｂ　37/04　Ａ
Ｂ２４Ｂ　37/04　Ｆ
Ｂ２４Ｂ　37/04　Ｒ
Ｈ０１Ｌ　21/304　６２２Ｆ
Ｈ０１Ｌ　21/304　６２１Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成24年9月10日(2012.9.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
被処理物の第１の面側を研磨するための第１の定盤と、
前記第１の面の裏側である第２の面側を研磨するための第２の定盤とを備え、
前記第１の定盤は、平面視で円環状であり、中心に向かって凸の円錐台状の研磨面を有し、
前記第２の定盤は、平面視で円環状であり、前記第１の定盤とそれぞれの円環の中心が合うように研磨面どうしを重ね合せたときに、前記第１の定盤の前記研磨面と相補的に合致し、中心に向かって凹の円錐台状の研磨面を有することを特徴とする定盤セット。
【請求項２】
前記第１の定盤および前記第２の定盤は、前記研磨面に開放する溝を有している請求項１に記載の定盤セット。
【請求項３】
請求項１または２に記載の定盤セットと、
前記第１の定盤と前記第２の定盤とに挟まれる位置にあり、前記第１の定盤の前記研磨面および前記第２の定盤の前記研磨面に対して相対的に移動する保持部と、
を有することを特徴とする研磨装置。
【請求項４】
厚み方向に反りを有する板状の被処理物の前記厚み方向を研磨する研磨方法であって、
前記反りの方向を測定する測定工程と、
平面視で円環状であり、中心に向かって凸の円錐台状の研磨面を有する第１の定盤と、平面視で円環状であり、前記第１の定盤とそれぞれの円環の中心が合うように研磨面どうしを重ね合せたときに、前記第１の定盤の前記研磨面と相補的に合致し、中心に向かって

凹の円錐台状の研磨面を有する第２の定盤とに挟まれるように、前記被処理物の反りの形状が凸になっている側の面を前記第１の定盤の研磨面側になるように前記被処理物を配置する配置工程と、

前記第１の定盤および前記第２の定盤と、前記被処理物とを相対的に移動させることにより、前記被処理物の前記厚み方向を研磨する研磨工程と、

を含むことを特徴とする研磨方法。